

特定施設(水質基準適用施設)の種類

施 設 の 種 類	
1	硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設
2	カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設
3	硫酸カリウムの製造の用に供する廃ガス洗浄施設
4	アルミナ繊維の製造の用に供する廃ガス洗浄施設
5	担体付き触媒の製造(塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。)の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する廃ガス洗浄施設
6	塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設
7	カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る。)の用に供する硫酸濃縮施設、シクロヘキサン分離施設、廃ガス洗浄施設
8	クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する水洗施設、廃ガス洗浄施設
9	4 - クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供するろ過施設、乾燥施設、廃ガス洗浄施設
10	2,3 - ジクロロ - 1,4 - ナフトキノンの製造の用に供するろ過施設、廃ガス洗浄施設
11	ジオキサジンバイオレットの製造の用に供するニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設、ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設、ジオキサジンバイオレット洗浄施設、熱風乾燥施設
12	アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設
13	亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する精製施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設
14	担体付き触媒(使用済みのものに限る。)からの金属の回収(ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法(焙焼炉で処理しないものに限る。))によるものを除く。)の用に供するろ過施設、精製施設、廃ガス洗浄施設
15	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であって、汚水又は廃液を排出するもの
16	廃PCB等又はPCB処理物の分解施設、PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設
17	フロン類(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平成6年政令第308号)別表1の項、3の項及び6の項に掲げる特定物質をいう。)の破壊(プラズマを用いて破壊する方法その他環境省令で定める方法によるものに限る。)の用に供するプラズマ反応施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設
18	下水道終末処理施設(1～17及び19の施設に係る汚水又は廃液を含む下水を処理するものに限る。)
19	1～17の施設を設置する工場又は事業場から排出される水の処理施設